

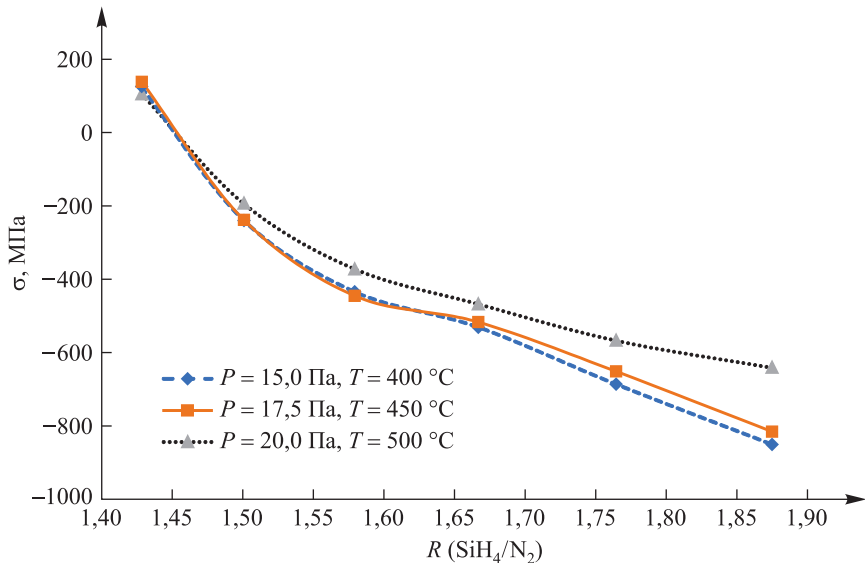


Рис. 3. Зависимость остаточных механических напряжений в пленках SiN_x от соотношения потоков газов SiH_4/N_2 для трех комбинаций давления и температуры

Fig. 3. Dependence of residual mechanical stress in SiN_x films on the gas flow ratio SiH_4/N_2 for three combinations of pressure and temperature